

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 21 年 2 月 12 日 (2009.2.12)

【公開番号】特開 2007-250568 (P2007-250568A)
【公開日】平成 19 年 9 月 27 日 (2007.9.27)
【年通号数】公開・登録公報 2007-037
【出願番号】特願 2006-67733 (P2006-67733)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/31 C

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 12 月 24 日 (2008.12.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被処理体を収容する処理容器と、この処理容器内で被処理体に所定の処理を施す処理機構と、前記処理容器の上部に開閉可能に設けられた蓋体と、蓋体を開閉する開閉機構とを具備し、

前記開閉機構は、前記処理容器の一方の端部に蓋体を回動可能に連結するヒンジ部と、前記蓋体を回動させる駆動部とを有し、

前記ヒンジ部は、前記駆動部によって前記蓋体を回動させる際の回動軸となる主軸と、前記主軸の先端側に設けられ、蓋体の角度調整が可能な調整軸とを有することを特徴とする処理装置。

【請求項 2】

前記ヒンジ部は、前記調整軸を軸として前記蓋体を回動させることにより前記蓋体の位置を調節する位置調節部を有していることを特徴とする請求項 1 に記載の処理装置。

【請求項 3】

前記位置調節部は、前記蓋体の上下方向の位置も調節可能であることを特徴とする請求項 2 に記載の処理装置。

【請求項 4】

前記蓋体と前記処理容器との間にシール部材が介在されていることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の処理装置。

【請求項 5】

前記処理機構による処理は、前記処理容器内を真空にして行われることを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれか 1 項に記載の処理装置。

【請求項 6】

前記処理機構は、マイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、前記蓋体に設けられ、前記マイクロ波発生部で発生したマイクロ波を前記処理容器に導くアンテナと、前記処理容器内に処理ガスを導入する処理ガス導入機構とを有し、前記マイクロ波により前記処理容器内に処理ガスのプラズマを形成することを特徴とする請求項 5 に記載の処理装置。

【請求項 7】

被処理体を収容する処理容器内で被処理体に所定の処理を施す処理装置において、前記処理容器の上に設けられる蓋体を開閉する蓋体の開閉機構であって、

前記処理容器の一方の端部に蓋体を回動可能に連結するヒンジ部と、前記蓋体を回動させる駆動部とを有し、

前記ヒンジ部は、前記駆動部によって前記蓋体を回動させる際の回動軸となる主軸と、前記主軸の先端側に設けられ、蓋体の角度調整が可能な調整軸とを有することを特徴とする蓋体の開閉機構。

【請求項 8】

前記ヒンジ部は、前記調整軸を軸として前記蓋体を回動させることにより前記蓋体の位置を調節する位置調節部を有していることを特徴とする請求項 7 に記載の蓋体の開閉機構。

【請求項 9】

前記位置調節部は、前記蓋体の上下方向の位置も調節可能であることを特徴とする請求項 8 に記載の蓋体の開閉機構。